

## เอกสารอ้างอิง

1. A. Fujishima, T.N. Rao and D.A. Tryk, 2000, "**Titanium dioxide photocatalysis**", Journal of Photochemistry and Photobiology, pp.1-21.
2. U. Diebold, 2003, "**The surface science of titanium dioxide**", Surface Science Report. 48, pp.53-229.
3. P. Zeman, S. Takabayashi, 2003, "**Nano-scale photocatalytic TiO<sub>2</sub> thin films prepared by magnetron sputtering**", Thin Solid Films 433, pp.57-62.
4. M. Yamagishi, S. Kuriki, P.K. Song and Y. Shigesato, 2003, "**Thin films TiO<sub>2</sub> photocatalyst deposited by reactive magnetron sputtering**", Thin Solid Films 442, pp. 227-231.
5. P. Zeman and S. Takabayashi, 2002, "**Effect of total and oxygen partial pressures on structure of photocatalytic TiO<sub>2</sub> films sputtered on unheated substrate**", Surface and Coatings Technology 153, pp.93-99.
6. M.C. Barnes, S. Kumar, L. Green, N-M. Hwang and A.R. Gerson, 2004, "**The mechanism of low temperature deposition of crystalline anatase by reactive magnetron sputtering**" Surface and Coatings Technology 190, pp.321-330.
7. T. Miyagi, M. Kamei, T. Ogawa, T. Mitsuhashi, A. Yamazaki and T. Sato, 2003, "**Pulse mode effects on crystallization temperature of titanium dioxide films in pulse magnetron sputtering**" Thin Solid Films 442, pp.32-35.
8. Y.X. Leng, J.Y. Chen, P. Yang, H. Sun and N. Hung, 2003, "**Structure and properties of passivating titanium oxide films fabricated by DC plasma oxidation**", Surface and Coatings Technology, 166, pp.176-182.
9. T. Takahashi and H. Nakabayashi, 2002, "**Dependence of working gas pressure and ratio of Ar to O<sub>2</sub> on properties of TiO<sub>2</sub> films deposited by facing targets sputtering**", Thin Solid Films 420-421, pp. 433-437.
10. Hou, Y.-Q., Zhuang D.-M., Zhang G., Zhao M. and Wu M.-S., 2003, "**Influence of annealing temperature on the properties of titanium oxide thin film**", Applied Surface Science, Vol. 218, pp. 97-105.

11. Qourzal, S., Assabbane, A. and Ait-Ichou., Y., 2004, "Synthesis of  $TiO_2$  via hydrolysis of titaniumtetraisopropoxide and its photocatalytic activity on a suspended mixture with activated carbon in the degradation of 2-naphthol", **Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry**, Vol. 163, pp. 317-321.
12. Igor, N.M. and Kenneth J.K., 2004, "Comparative study of  $TiO_2$  particles in powder form and as a thin nanostructured film on quartz", **Journal of Catalysis**, Vol. 225, pp. 408-416.
13. สุรสิงห์ ไชยคุณ, นิรันดร์ วิทิตอนันต์, จักรพันธ์ ถาวรธิดา และ สกฤต ศรีญาณลักษณ์, 2547, "เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเคลือบในสุญญากาศกับการประยุกต์ทางอุตสาหกรรม", ภาควิชา ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, หน้า 27.
14. สุพัฒน์พงษ์ คำรงค์รัตน์, พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ และ พิษณุ เจริญสมศักดิ์, 2531, "รายงานวิจัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนาการเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีสเป็คเตอรืง", ภาควิชา ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, หน้า 1-72.
15. ชีวรัตน์ ม่วงพัฒน์, 2544, การสร้างและศึกษาลักษณะของอิลเลคโทรดประเภทฟิล์มบางโปร่งแสง, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและวัสดุ คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, หน้า 3-60.
16. โชคชัย หาญธนชาติ, 2540, การเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธี ดี.ซี. พลาสมา แมกนีตรอน สเป็คเตอรืง, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, หน้า 7-24.
17. Diebold, U. 2003, "The surface science of titanium dioxide", **Surface science reports**, Vol. 48, pp. 53-229.
18. ramé-hart instrument co., **contact angle goniometers and accessories** [Online], Available : <http://www.ramehart.com/goniometers/images/ca2.jpg> [2008, April 4].
19. [www.nanopin.cz/en/en\\_page01.html](http://www.nanopin.cz/en/en_page01.html).
20. S. Berg, T. Nyberg, 2005, "Fundamental understanding and modeling of reactive sputtering processes", **Thin Solid Films**, Vol. 476, pp. 215-230.